

特許 & 技術レポート

河 合同特許法律事務所/SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

2025-2

ハイライト：

審査処理期間の変化及び審査順位の変更	1
特許・デザイン登録が早くなる…特許審判院、拒絶決定不服審判の認容時に直ちに登録決定	2
特許審判院、ソウル取引非上場へのDunamuの特許無効審判請求を認容	3
K-POP活性化の立て役者ペンライト、特許侵害訴訟戦が話題…大法院の判決覆されるか	4
グラフェンと超伝導体の出会い…電極接合の画期的改善	5



IP制度

審査処理期間の変化及び 審査順位の変更

2025年1月1日から施行されている特許・実用新案審査事務取扱規定の改正に伴い、審査順位又は審査処理期間が次のように変更された。

① 分割出願の審査順位が変更され、従来は原出願の審査請求順に従い分割出願を迅速に処理してきたが、今後は、米国・日本等の主要国と同様に分割出願自体の審査請求順に審査する。2025年1月1日以降に審査が行われた出願から適用されている。

② 特許審査ハイウェイ (PPH) 出願に対する審査着手の期限が、優先審査の決定日から3ヶ月に短縮された。これは、従来の期限4ヶ月から短縮されたもので、優先審査による特許権の確保が一層早まると予想される。2025年1月1日以降、優先審査が申請された出願から適用されている。

③ 特許拒絶決定後、不服審判の代わりに請求できる再審査の審査着手処理期限は、これまでの1ヶ月から6ヶ月に延長された。再審査の期限は、延長することで一般の審査処理を拡大する見通しだ。これは、2025年4月1日以降に再審査が行われる出願から適用される。

④ 審査順位の例外に「国際出願 (PCT出願) の基礎となる先出願」が追加された。これに伴い、国際出願の基礎となる出願は優先的に審査され、後続の海外出願の手続きが円滑となるよう改善される見通しだ。

また、特許庁全体の努力として管理者レベルの

業務を拡大するなど、可能な人材を審査処理に集中させる方針だ。

管理者レベル（審査部所長、チーム長）の審査官が目標とする審査処理の量を「2025年に一時的に拡大する。審査官による職権補正を活性化して、不要な行政手続きを最小化し、出願人の負担も減らす。また、審査処理期間をより安定して管理するため、関係部所との協力を通じて追加の審査人材の確保にも総力を傾ける。今回の計画を通じて、「2024年に16.1ヶ月（技術分野全体の基準）を要した審査処理期間が、2025年には1ヶ月短縮され15.1ヶ月を記録することが見込まれる。また、対内外の環境の変化に弾力的に対応するため、中長期的な観点による特許審査サービスの革新案を樹立する計画だ。

特許・デザイン登録が早くなる… 特許審判院、拒絶決定不服審判の 認容時に直ちに登録決定

審判手続きの改善で最大で2ヶ月短縮、早期権利化に期待

特許及びデザイン登録がより迅速になる制度を導入

特許審判院は、2025年1月から特許及びデザイン登録に関する拒絶決定不服審判の手続きを改善した。審判官は、拒絶決定に対する審判過程で登録決定が妥当であり、これ以降争点がないと判断される場合、直接審決を通じて登録決定をすることができる。

これまで、拒絶決定不服審判で出願人の主張が受け入れられても、審査官が再度検討する手続きを経なければならなかった。そのため、登録決定までの時間が遅延することも多かった。しかし、これからは、追加審査を必要とする場合を除き、審判官は直ちに登録決定することができ、出願人の特許及びデザイン登録が、従来より1~2ヶ月早まることが期待される。

特許審判院は、審査段階で検討されなかった争点が残っていたり、新たな拒絶理由が発見された場合のみ審査官に戻す方式により手続きを簡素化した。

これにより、繰り返される審査手続きを減らし、出願人の権利確保が早まるようにした。

特許審判院長は、今回の改善について「審判手続きが繰り返される不便さが解消され、早期の権利確保に大きく役立つはず」としながら、「特許審判院は、今後も顧客中心の観点で制度を改善し、不合理な点は積極的に解消していく」と語った。

今回の制度改善により、特許及びデザイン出願の登録遅延が減り、出願人の時間的及び経済的負担が減るものと思われる。さらに、技術やデザインの商用化を早期に実現でき、国内産業の競争力強化にもプラスの影響を及ぼすものと期待される。

特許技術の保護及び医薬品の選択権 拡大のための特許法・実用新案法 改正案が国会で可決

—2025年1月公布、公布後6ヶ月後に施行

特許侵害製品の輸出制裁が強化される。

韓国の現行法では、特許侵害製品の輸入だけが特許侵害の類型に含まれていたが、今回の改正で、輸出も特許侵害の類型に追加されることになった。これにより、特許権者は、特許侵害製品を輸出した者を対象として損害賠償請求及び刑事責任を問うことができる。特許権者は、侵害製品と輸出者に対して侵害差止請求と共に最大7年以下の懲役または1億ウォン（約1,060万円）以下の罰金の賦課が可能となる。

医薬品特許権の存続期間の上限も導入される。

医薬品特許権存続期間延長制度は、発明が許可を得られずに実行されなかった期間を補償するための制度だ。しかし、韓国は延長可能な上限がなく、医薬品特許権が過度に延長されるケースが多かった。

一部の医薬品の場合、主要国よりも特許権の存続期間が相対的に長く延長され、ジェネリックの発売が遅れることで、消費者の医薬品選択権の縮小、健康保険財政の悪化などの問題が発生し得るという声があがっていた。

今回の改正で、医薬品の許可日から14年を超えて

はならない上限が設けられ、一つの許可に対して一つの特許権のみ延長が可能という、延長特許権の数も制限している。

今回の改正法により、医薬品存続期間の延長を米国、欧州など国際的基準に合わせることができ、過度な存続期間の延長を防止することで、需要者の医薬品選択権を拡大し、健康保険財政の節減にも寄与できるものと予想される。

商標・デザイン権侵害、懲罰的損害賠償5倍…7月22日施行

今年7月22日から商標権及びデザイン権を故意に侵害した場合、最大で5倍の懲罰的損害賠償が課される。特許庁は、かかる内容を盛り込んだ改正商標法及びデザイン保護法が1月21日に公布され、6ヵ月後に施行されることを明らかにした。

今回の改正は、従来の3倍の懲罰的損害賠償の限度を5倍に引き上げるといのが骨子だ。これは、昨年8月に特許法及び不正競争防止法に導入された5倍の懲罰的損害賠償制度を、商標・デザイン分野に拡大した措置となる。

特許庁によると、国内のオンライン偽造商品の取り締まり件数が、2020年の13万7千余件から2024年には27万2千余件と5年で2倍近く増加している。これに伴い、より強力な権利保護措置が必要という指摘が提起されてきた。5倍の懲罰賠償は、主要国と比べても最高レベルだ。日本には商標権・デザイン権侵害に対する懲罰的損害賠償制度がなく、米国はデザイン権侵害に対してのみ最大3倍までの懲罰賠償を許容している。これまでに最大5倍の賠償を規定している国は中国が唯一とのことだ。

特許庁長は、「今回の改正で商標・デザイン侵害に対するより実効的な権利救済が可能となった」とし、「懲罰的損害賠償がきちんとされるためには侵害行為に対する故意性の立証が必要であり、そのためには、証拠収集が先行されなければならないだけに、韓国に合った証拠収集などの制度改善も積極的に推めてゆく」と明らかにした。



紛争

特許審判院、ソウル取引非上場へのDunamuの特許無効審判請求を認容

非上場株式取引プラットフォームである『ソウル取引非上場』と『証券プラス非上場』との間の特許紛争で、特許審判院はDunamuが運営する、証券プラス非上場に軍配をあげた。

特許審判院は2024年11月末、ソウル取引非上場の一部数量の即時締結サービスに対する特許無効審判請求を認容する決定を下した。

Dunamuとソウル取引間の非上場取引プラットフォームの特許紛争は、昨年5月に始まった。ソウル取引非上場は「証券プラス非上場がソウル取引の『一部数量の即時締結』機能に関する特許権を侵害した」としてDunamuに内容証明を発送し、これに対しDunamuは「ソウル取引の一方的な主張であり、他社に対する根拠のない誹謗」として当該特許に対する無効審判を請求した。ソウル取引はこれに反発し、特許侵害差止め仮処分申請を出した。

激しく対立していた両社が法的紛争に入ると、特許無効審判の結果に業界の関心は集中した。特許無効審判の場合、当該特許が有効なのか(特許要件をきちんと備えているか)に対する判断を行い、これは特許侵害の有無において優先的に判断されなければならない要素である。

特許審判院は、無効判断の理由として、ソウル取引の特許発明が韓国の上場株式市場の証券取引、米国の電子ブロック取引など既に公開されている技術と差がないという点を挙げた。また、一定の要件を満たす場合、売り手に再度確認する過程を通さず即時に契約が締結される機能の構成も実質的に既存の技術と同様と見た。

Dunamu側は、「特許審判院の判断を歓迎する」としながら、「今後、残りの法的手続きにおいても誠

実に臨むつもり」と明らかにした。

「K-POP活性化の立て役者」ペンライト、「特許侵害訴訟戦」が話題… 大法院の判決覆されるか



写真-Fanlight

「K-ペンライト」関連の「特許侵害訴訟戦」が業界の関心を集めている。大法院までの激しい訴訟戦が繰り広げられる中、本事件における判決が、ITを土台とするK-popにおけるビジネスモデル(BM)の新たな道しるべとなると見られるためだ。

業界によると、韓国最大のペンライト業者である『Fanlight』が、自社の特許を侵害したとして、2020年から『VITRO』を相手に提起してきた訴訟が、最近、大法院までいく激しい法理論争の末、上告審において審理が継続されることとなった。

大法院の上告審裁判部は、FanlightがVITROを相手に提起した「特許権侵害訴訟」の審理がさらに必要であるとした。平均70%を越える棄却率を示す上告審では、相当異例の決定となる。

これは、VITROに軍配をあげた1審と2審に対し、大法院が再度審理すべきという決定を下したもので、業界では訴訟結果が覆される可能性についても注意深く見守っている。

Fanlightの関係者は、「今回の結果は、1、2審の結果に対し再度の審理を求めたFanlightの主張を大法院が受け入れたものと解釈できる」とし、「技術的に高い理解度が要求される特許侵害訴訟の特性上、被告(VITRO)側に有利な判決を下した1、2審の裁判部は、技術的理解度が低い中で誤った判決をしたこと

を示す結果とも見られる」と説明した。

業界では、今回の決定が2019年に新設された「特許法第126条の2(行為態様の提示義務)に対する法の適用も不備であったことを指摘したもの」と解釈している。

ある関係者は、「特許法第126条の2(行為態様の提示義務)に関する法は、原告が特許権侵害の具体的な行為を提示した場合、これを否認する被告は自身が具体的に特許侵害がないことを立証しなければならない。万一、被告がそれに関して適法な答弁を出せなかった場合、原告の主張を認めて原告の勝訴と見ることができると、下級審ではこの点が看過されたといえる」と伝えた。

ある法律関係者は、「原告が保有している特許技術は、目に見えない無線制御信号を通じて数万個のペンライトをリアルタイムで制御するものだが、目に見えないだけに、技術に対する理解が十分でなければ全く異なった判断や結果が出されることがある」と語った。

さらに、「特許法上の侵害とは、原告の登録特許の権利と、被告が業として実施した技術に関して侵害であるか否かを判断するものであり、この時、被告側は侵害訴訟で自身が実際に業として実施した技術に関して提示するのが一般の常識であるにもかかわらず、被告は1審から2審の裁判過程の中で原告の指摘がある度に自身の主張を変更・撤回してきたものと思われる。かかる点から推し量ると、被告は、特許法第126条の2第1項に規定される業として実施した『自己の具体的な行為態様』を提示していないものと判断され、2審の裁判部は十分な技術的理解のないままこれを看過したものと判断される」とした。

また、「大法院の裁判部が審理不続行期間を徒過して審理を継続していることは、上記のような内容を審理し、被告の特許権侵害有無を再度判断する余地があるとしたもの」と加えた。

一方、2020年12月31日に特許庁に提出されたある法務法人の研究報告書「特許侵害判例の分析による中小ベンチャー企業の侵害訴訟対応戦略の研究」によると、中小企業が特許侵害訴訟の原告の立場で障壁となる困難については、侵害の立証の困難及び法

院の専門性不足等の意見があり、特許法第126条の2（具体的行為態様の提示義務）に関しては、当事者の具体的行為態様の提示義務の不履行に対して特別な不利益条項がないため適用が難しい、また、当事者が自身に有利な行為態様のみを提示することがあるため侵害の態様を正確に把握できない、という意見があった。

このように、中小企業が中核的な特許権を有していても、侵害立証責任等が不利な点を甘受して訴訟を行わなければならない負担があり、目に見えない電気電子、BM発明に関する技術を侵害している被告が、虚偽の主張を行ったり証拠資料を提出せずに持ちこたえるなど、侵害技術を隠そうとするならば、特許権を有している原告は次第に特許権侵害の立証が困難な領域に陥らざるを得ない、というのが実情だ。

エンタメ業界の関係者は、「韓国コンテンツが世界的に大きな人気を集めている中、これに関するBM発明特許も、当然保護されることで持続した韓流の活性化につながる」とし、今回の訴訟が如何なる結果となるかに関心をもたれている。

ペプシコvsライズアンドシャインの 商標侵害訴訟の結論は

1月15日、外信によると米国第2連邦巡回控訴裁判所は、ペプシコの「MTN DEW RISE ENERGY」商標がライズアンドシャインの「RISE BREWING」商標を侵害していないという原審判決を確定した。

ライズアンドシャインは、缶コーヒー飲料製品に「RISE」を使って販売しており、缶エネルギー飲料に使用するペプシコの「MTN DEW RISE ENERGY」商標が自身のブランドと混同を生じさせるおそれがあると主張して、2021年に1審であるニューヨーク南部地方裁判所に当該商標の使用を差止める予備禁止命令を申請した。1審の地方裁判所は、ライズアンドシャインの予備禁止命令の請求を受け入れた。

2022年、ペプシコはこれを不服として控訴し、第2連邦巡回控訴裁判所はペプシコの商標権侵害を認めず、予備禁止命令認容判決を棄却した。

続けて行われた2023年1審の地方裁判所の略式判決でもペプシコが勝訴すると、ライズアンドシャインはこれを不服として控訴を提起した。

控訴審では、ライズアンドシャインの「ライズ」はコーヒー製品に対する固有の識別力が弱く、きわめて狭い範囲でのみ保護を受けることができ、商標の強さに関して、「ライズ」という用語が消費者にライズアンドシャインの製品と認識されるか十分な証明がなされていないと判断した。

また、消費者の混同の可能性についても裁判所の判断基準であるポラロイドファクターの分析結果がペプシコに有利に作用しており、ペプシコが「ライズ」という用語を使用することにより消費者が製品の出所を混同する可能性は低いと判断した。

ポラロイドファクターは、△商標の識別力△商標の類似性の程度△商品の近接性及び互いの競争力△原告が被告の市場で販売する製品を開発して格差を解消する可能性△実際の消費者における混同の証拠△被告が悪意で模倣用語を採択したという証拠△各製品の品質△関連の消費者集団のレベルで構成されている。



グラフェンと超伝導体の出会い… 電極接合の画期的改善

国内外の研究陣で構成された国際共同研究チームが、グラフェンと超伝導電極の接合特性の画期的な改善に成功した。二次元超伝導接合技術で次世代電子機器の開発に使われることが期待される。

浦項工科大学は2024年12月31日、物理学科のイ・ギルホ教授と日本の物質・材料研究機構(NIMS)の渡邊賢治司特命研究員の研究チームとの協力により、グラフェンと超伝導電極の接合特性の画期的な改善に成功したと明らかにした。

超伝導体は、特殊な条件で抵抗がゼロになる物質だ。一般の導体と結合すると超伝導性が導体に伝達される「近接効果」が現れる。この現象は、電子機器の性能を極大化する中核技術で、ジョセフソン接合や位相超伝導開発などの応用分野で重要な役割をする。ジョセフソン接合は、二つの超伝導体の間に薄い絶縁層あるいは非超伝導体を挿入した構造であり、位相超伝導は、量子力学の位相物理学と超伝導体の特性を結合した新たな形態の超伝導状態だ。

グラフェンは、電気伝導性に優れて電子移動速度が速く、超伝導体と導体を連結する理想的な材料として注目されてきた。しかし、従来の方法では超伝導体がグラフェンに電子を注入する過程で電子が抜け出して「ホールドーピング」状態となる。これにより、超伝導体とグラフェンとの間に「PN界面」という境界が形成された。この境界は、接合透過度を低くして近接効果を弱化させ、超伝導体がグラフェンに電気を効率的に伝達する上で妨害となっていた。

これを解決するため、研究チームは、グラフェンの電荷密度を精密に制御できる新たな接合方法を開発した。また、グラフェンを保護する不導体である六方晶系窒化ホウ素(h-BN)の特定部分を精密に削り取ってグラフェンの表面を露出させ、この上に超伝導体を接合した。この方法は、既存の一次元接合とは異なり、グラフェンの電荷密度と極性をゲート電圧を通じて調節することができる。これを通じて、ホールドーピング状態でも超伝導体とグラフェンとの円滑な連結が可能となり、強力な超伝導近接効果と高い

接合透過度を維持することができる。

研究チームは、「既存の一次元接合方式は、グラフェンの極性を自由に制御し難い限界があった」とし、「今回の研究で開発した二次元超伝導接合技術は、グラフェンの電気的特性を精密に調節することができるため、新たな電子素子や研究分野が開かれるだろう」と語った。

同研究結果は、国際学術誌「Nano Letters」2024年11月28日号に掲載された。

韓国における知的財産問題でお悩みですか 新しい選択、HA&HAにお任せ下さい。

(調査、特許・実用新案・デザイン・商標の出願及び登録、著作権、電子商取引、
インターネット上の権利、コンピュータープログラム、侵害訴訟及び各種紛争)

河 合同特許法律事務所

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-548-1609
Fax : +82-2-548-9555, 511-3405
E-mail : haandha@haandha.com
Website : <http://haandha.com>

SEOUL TECHNO R&C CO., LTD.

ソウル市瑞草区Juheung 3-Gil 1 栄和B/D(盤浦洞)
Tel : +82-2-3443-8434
Fax : +82-2-3443-8436
E-mail : st@stpat.co.kr